2020-半導體&綠能元件鍍膜技術與 Macleod 薄膜設計研討會

源 由: 真空鍍膜技術的發展，攸關國家科技的進步，全球重要半導體製程與綠能元件都需要真空鍍膜技術的支援，近年來台灣在半導體製程與綠能元件裝置產業上，都有創新與嶄新的技術發展，更是需要真空鍍膜技術與光學薄膜設計的技術發展配合，因此舉辦一場半導體&綠能元件鍍膜技術與 Macleod 薄膜設計研討會。研討會中很榮幸邀請國家實驗研究院儀器科技研究中心、核能研究所物理組與業界專家說明最新發展高能 PVD 真空鍍膜技術應用、單層原子沉積(ALD)在半導體製程技術開發、全固態電致變色鍍膜技術發展與 Macleod 光學薄膜設計等，可以分別應用在半導體製程與綠色能源元件發展上。上午期間第一場邀請到國研院儀科中心\鍍膜元件組廖博輝博士演講關於儀科中心最新發展高能 PVD 鍍膜技術應用。第二場將邀請國研院儀科中心\ALD 製程暨設備發展組卓文浩副研究員演講關於 ALD 原子層沉積技術開發與應用。下午期間第一場邀請到核能所物理組陳柏聞博士介紹全固態電致變色鍍膜技術發展。第二場邀請到宗豪科技股份有限公司蘇朝盈先生講授 Macleod 光學模擬軟體基礎操作及上機實作，並且演習實際案例設計說明，希望大家能夠獲得真空鍍膜與光學薄膜的實務設計經驗。最後感謝雲林科技大學的**高教深耕計畫中心、教學卓越中心、工程學院、電子工程系、國家實驗研究院台灣儀器科技研究中心、原子能委員會核能研究所**與**宗豪科技股份有限公司**的全力支援。

時 間: 109.09.10 (週四)

地 點: 國立雲林科技大學 演講在工程五館 EB107 演講廳與上機實作在工程三館 ES302 電腦教室。

主辦單位: 雲科大高教深耕計畫中心、教學卓越中心中心、雲科大工程學院、雲科大電子系。

協辦單位: 宗豪科技股份有限公司

人 數: 40 人

費 用: Free (中午供餐)

報名方式 : 9/8(二)報名截止，採網路報名。

報名網址 : https://webapp.yuntech.edu.tw/Activities/Activities/Details?activityID=40421

聯絡人: 嚴瑜宏同學 E-mail: m10813041@yuntech.edu.tw TEL:(05)5342601 ext 4373
鄭雅駿同學 E-mail: m10813025@yuntech.edu.tw TEL:(05)5342601 ext 4373

議程:

時間	單位	講員	講題
08:30-08:50	報到		
08:50-09:00	長官致詞 (工程學院 王院長)		
09:00-10:30	國研院儀器中心\真空鍍膜與光學元件組	廖博輝 博士	高能 PVD 真空鍍膜技術應用
10:40-12:10	國研院儀器中心\ ALD 製程暨設備發展組	卓文浩 副研究員	ALD 製程技術開發與應用介紹
12:10-13:00	午休 (用餐時間 ES102)		
13:10-14:40	原子能委員會核能研究所/物理組	陳柏聞 博士	全固態電致變色鍍膜技術發展
15:00-15:50	宗豪科技股份有限公司	蘇朝盈 講師	Macleod 鍍膜模擬設計及上機實作(Ⅰ)
15:50-16:50	宗豪科技股份有限公司	蘇朝盈 講師	Macleod 鍍膜模擬設計及上機實作(Ⅱ)